

### 3. 参加者一覧

#### 福井県地域結集型共同研究事業 参加者一覧

研究テーマ	産業界	学术界	行政	雇用研究員	事業終了後の予定
高出力・超短パルス Yb:YAG 固体レーザーの研究	前田工織(株)：曹健	分子科学研究所： ・平等拓範 ・庄司一郎 ・石月秀貴 ・斎川次郎 大阪大学 ・片岡俊彦 福井大学 ・川戸栄	産業技術総合研究所 ・鳥塚健二 ・植村禎夫 ・小林洋平	(株)松浦機械製作所 ・田中隆三(H14 退) 福井大学 ・北島巖(H14 退) (財)ふくい産業支援センター ・常包正樹 ・末田敬一 ・Traian Dascalu (H16 退) ・Yang Hongru (H13 退)	所属元 所属元 分子科学研究所 福井大学 帰国 帰国
Yb:YAG レーザ光の波長可変法の開発	高嶋技研(株) ・西垣内章治 フクビ化学工業(株)： ・坂井紀夫	大阪大学 ・佐々木孝友 ・森勇介 ・吉村政志 分子科学研究所： ・平等拓範 福井大学 ・川戸栄	福井県工業技術センター ・松浦次雄 ・上山明彦 ・松山治幸	(財)ふくい産業支援センター ・石月秀貴(H14 退) 福井大学 ・北島巖(H14 退)	分子科学研究所 所属元
多機能フォトンマシニングセンタの開発	松下電工(株) ・吉田徳雄 ・安部諭 ・東喜万 ・峠山裕彦	福井大学： ・岩井善郎 ・竹下晋正 大阪大学 ・小阪田宏造 ・塩見誠規	福井県工業技術センター ・宮下正美 ・後藤基浩	(株)松浦機械製作所 ・富田誠一 ・田中隆三 ・市村誠 ・高岡勉(H15 退)	所属元 所属元 所属元 福井大学
レーザーブレイション機構と最適加工条件の解明	セーレン(株) ・高木進 ・近藤俊弘 ・櫻井理博 ・牧田博行 ・中村利岳 サンルックス(株) ・加藤住雄 ・宮下昭治	福井大学 ・香川喜一郎 ・上田正紘 理化学研究所 ・緑川克美	福井県工業技術センター ・高岡清彦 ・宮崎孝司 ・松尾光恭 ・宮下正美 ・強力真一 ・松井多志 ・青柳裕治 ・芦原彰彦	福井大学 ・香川喜一郎 (H16 退) ・本田知己(H14 退) ・山本富士夫(H14 退) ・仁木秀明(H14 退)	所属元 所属元 所属元 所属元
高出力パルスレーザーを用いた超鏡面洗浄技術の開発と機能性薄膜の創生	信越化学工業(株) ・大橋健 ・津森利宏 フクビ化学工業(株)： ・坂井紀夫 ・秋田清 ・兼岩秀和 ・大谷幸宏 ・豊嶋雅子	京都大学 ・宮崎健創 東京工業大学 ・中川茂樹 福井工業高等専門学校 ・山本幸男	福井県工業技術センター ・高岡清彦 ・宮崎孝司 ・上山明彦 ・佐治栄治 ・真柄宏之 ・青柳裕治 ・野村光司 ・小林真	アイテック(株) ・木内淳介 福井工業高等専門学校 ・太田泰雄 ・安丸尚樹 ・北浦守 ・米田知晃 (H14 退)	所属元 所属元 所属元 所属元 所属元
高出力パルスレーザーを用いた長寿命 HID ランプの創成	ハリソン東芝ライティング(株) ・野口英彦 (株)オーク製作所 ・芹澤和泉 ・西村強 ・小久保洋介 ・吉田雄介	福井工業高等専門学校 ・井上明浩 福井大学 ・葛生伸	福井県工業技術センター ・高岡清彦 ・真柄宏之	増永眼鏡(株) ・村田和男 ・梅田達夫 (H16 退)	所属元 退社
レーザー誘起光化学反応を用いた選択薄膜成長技術の開発	日華化学(株) ・南保幸男 (株)サーマルプリンタ研究所 ・岡本崇司 シプロ化成(株) ・高戸章暎	福井大学 ・山本嵩勇 ・中川英之 ・橋本明弘 福井工業高等専門学校 ・高山勝己 ・川本昂 ・山本幸男		福井大学 ・山本嵩勇 ・橋本明弘 (H14 退)	所属元 所属元
純 計	1 2 社(27 名)	7 機関(26 名)	2 機関(19 名)	6 機関(23 名)	